

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成27年1月29日(2015.1.29)

【公開番号】特開2012-130687(P2012-130687A)

【公開日】平成24年7月12日(2012.7.12)

【年通号数】公開・登録公報2012-027

【出願番号】特願2011-275139(P2011-275139)

【国際特許分類】

A 6 1 B 6/03 (2006.01)

【F I】

A 6 1 B 6/03 3 7 3

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月5日(2014.12.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

場を発生するように構成されている場発生器（14、16）と、ターゲットへ向けられる電子ビームを発生するように構成されている電子ビーム発生器（60）と、
第一のエネルギー・レベルの電子ビーム（18）及び第二のエネルギー・レベルの電子ビーム（20）を発生するために前記電子ビーム発生器を制御するように構成されている電圧制御器（1228）と、
前記電子ビームの少なくとも一つを偏向させるために場を制御するように構成されている場発生器制御器（14、16）と
を備えた X 線システム（10）であって、前記電子ビーム（22）は、前記第一のエネルギー・レベル（18）では第一の接触位置（24）において前記ターゲット（28）に衝突し、前記第二のエネルギー・レベル（20）では第二の接触位置（26）において前記ターゲットに衝突し、前記ターゲットは、前記第一の接触位置（24）及び前記第二の接触位置（26）において X 線を濾波するように構成されている、X 線システム（10）。

【請求項 2】

前記ターゲット（28）は、第一の低エネルギー・レベルのスペクトル（18）では低エネルギー X 線の第一の濾波を提供し、第二の高エネルギー・レベルのスペクトル（20）では低エネルギー X 線の第二の濾波を提供するように構成されており、前記第一の濾波は前記第二の濾波よりも少ない、請求項 1 に記載の X 線システム（10）。

【請求項 3】

前記電子回路（1228）は、1 秒間未満の時間内に前記第一の電圧から前記第二の電圧まで移行するように構成されている、請求項 1 または 2 に記載の X 線システム（10）。

【請求項 4】

前記第一の接触位置（24）及び前記第二の接触位置（26）は異なるターゲット材料を含んでいる、請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の X 線システム（10）。

【請求項 5】

前記第一の接触位置（24）及び前記第二の接触位置（26）は異なるターゲット角度を含んでいる、請求項 1 乃至 4 のいずれかに記載の X 線システム（10）。

【請求項 6】

前記第一の接触位置（２４）及び前記第二の接触位置（２６）は異なる厚みのターゲット材料を含んでいる、請求項１乃至５のいずれかに記載のＸ線システム（１０）。

【請求項７】

前記第一の接触位置（２４）及び前記第二の接触位置（２６）は異なるターゲット材料又は異なるターゲット角度又は異なる厚みの少なくとも一つを有する、請求項１乃至６のいずれかに記載のＸ線システム（１０）。

【請求項８】

前記第一の電圧は約６０ｋＶｐと約８０ｋＶｐとの間にある、請求項１乃至７のいずれかに記載のＸ線システム（１０）。

【請求項９】

前記第二の電圧は約１１０ｋＶｐと約１６０ｋＶｐとの間にある、請求項１乃至８のいずれかに記載のＸ線システム（１０）。

【請求項１０】

計算機式断層写真法（ＣＴ）イメージング・システムとして構成される、請求項１乃至９のいずれかに記載のＸ線システム（１０）。